



即时发表

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

Open Sky Communications

电话: +1-415-519-3915

电邮: dmoreno@openskypr.com

扫描电子显微镜在 **THE EBEBAM INITIATIVE** 在深度学习年度调查突显其重要性
ESOL, Fractilia and HJL Lithography 加入 the eBeam Initiative

圣荷西, 加州, 美国, 二零二二年三月一日—The eBeam Initiative, 一个致力于推动和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体, 今天宣布其对深度学习(DL)在光罩到晶圆流程中产品及应用的第二届年度会员公司调查结果。调查表已经从去年基础上更新, 新增应用的主角是扫描电子显微镜(SEM)的应用。由于 SEM 影像是像素强度组成的图形, 几乎所有基于深度学习计算机视觉有关的技术都可以用于 SEM 影像, 以增进光罩和晶圆的测量和分析。深度学习完整调查表可在到下面网络链接查询 www.ebeam.org.

The eBeam Initiative 还宣布该组织新增三个会员公司: ESOL, 一个提供 EUV 测量解决方案的先驱公司; Fractilia, 一个随机性测量和控制解决方案的引领公司; HJL Lithography, 一个光刻技术咨询公司; HJL Lithography 的首席光刻专家哈里. 赖文森 (Harry Levinson) 博士, 被选为声誉卓著的 SPIE 弗里兹.泽尼克 (Frits Zernike) 微影技术 2022 年度获奖者, 今天随后举行的 eBeam Initiative 第十四届年度网络会议上也会宣布这一喜讯。

深度学习已经被很多公司认为是保其成功的重要部分, 然而, 在 2021 年的 eBeam Initiative 精英调查中, 只有百分之二十二参与者认为深度学习在 2022 之前会成为光罩制造的竞争优势。“在图像处理上, 有丰富深度学习的工具可以选用, 所以, SEM 图像分析成位业界深度学习最先的应用的龙头是很自然的。但是, 在我们行业, 从制造晶圆或光罩样品中产生 SEM 图像比较昂贵, 且费时费力, 由于产权保密, 这些图像不能公开。这就使用数字孪生技术 (digital twins) 模仿产生 SEM 图像用于深度学习训练变成量产成功的决定因素, ” eBeam Initiative 的主办管理公司, D2S 执行长藤村 (Aki Fujimura) 先生表示。



藤村又表示，“恭贺我们的同事，哈里·赖文森（Harry Levinson）获得 SPIE 的弗里兹·泽尼克（Frits Zernike）微影技术奖的荣誉，也热烈欢迎我们新的会员。在我们一起共同努力发展最先进的技术，包括大光圈（high-NA）EUV 光罩和曲形光罩，我们期待他们的参与和贡献。”

关于 The eBeam Initiative（电子束倡议团）

The eBeam Initiative 是一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体；为有关电子束技术的教育和促进活动提供相应的论坛。The eBeam Initiative 的目标是增加电子束技术应用在半导体制造各领域中的投资；降低电子束技术应用的障碍，能够使更多集成电路设计完成，并且更快投进市场成为可能。会员公司，涵盖整个半导体生态系统，包括：aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; ASML; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; ESOL; Fractilia; Fraunhofer IPMS; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GlobalFoundries (GF); Grenon Consulting; Hitachi High-Tech Corporation; HJL Lithography; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photronics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMITEC; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Inc.; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS. The eBeam Initiative 面向和欢迎所有电子工业的公司和协会加盟。细节请查看 www.ebeam.org.

###